

F37

薄膜分析仪



在线监测

免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

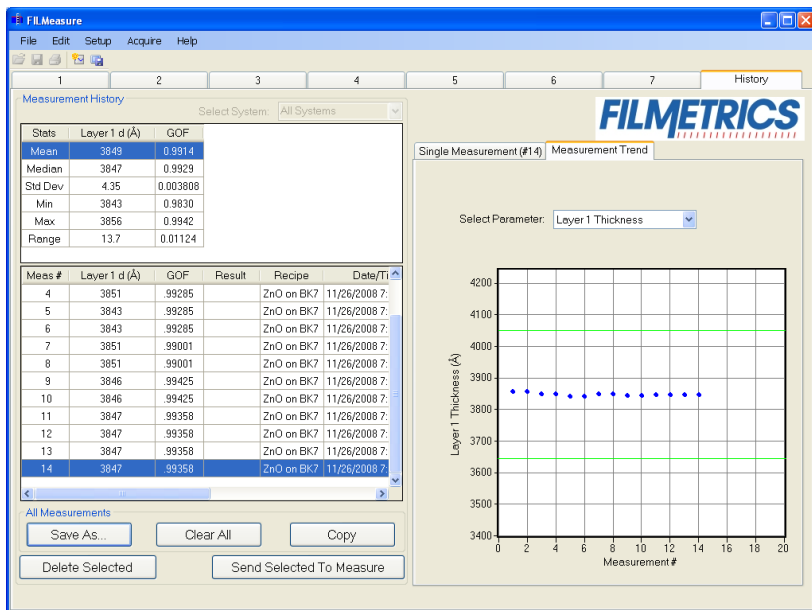
Filmetrics优势

- 内置自动波长校准
- 包括独立软件
- 多功能历史纪录能储存，复制，绘制测量结果

附带的软件和USB连接界面使F37易于安装到任何Windows平台的PC，功能强大的软件预载了超过百种材料的光学参数，这有助于多种不同膜层结构的量测，不论是单层、多层堆叠，甚至是单一纯物质，用户能轻易地从资料库中找到适用的模型以进行测量分析如果是没有预载的材料，用户只要将所知的材料光学参数直接导入资料库，或者经由量测，把所得的光学数据储入，即可使用。

多点量测系统，单一机台最多可搭配七组光谱仪

高性价比的F37机型因配置了先进的光谱测量系统，能够迅速快捷的应用于工业生产在线测量膜层的厚度，及光学常数(n, k值)，通过对待测膜层上下表面的反射光谱的分析就能够在数秒内获得厚度，折射率及消光系数。

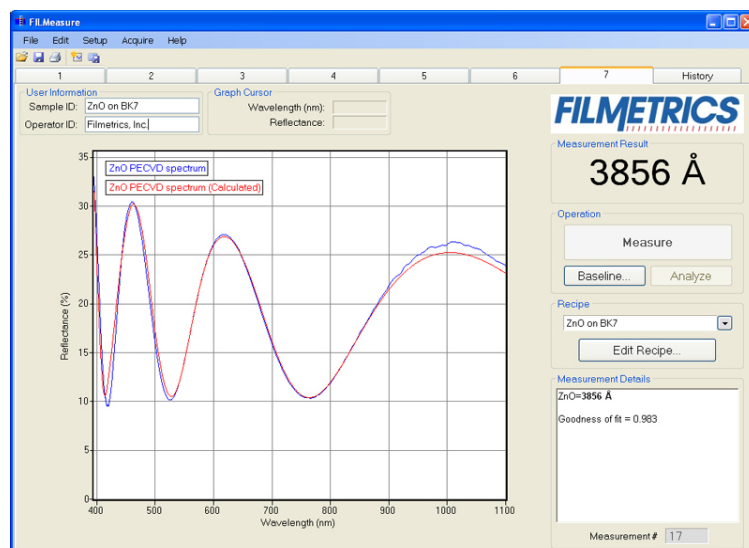


F37先进光谱测量系统，采用标准19英寸的机架式工业机箱，最多能配置7个独立的光谱仪。F37测量软件亦可被主机通过数位化I/O软件控制来进行测量。测量数据能够自动输出到主机供SPC控制。此外，为了满足不同的测量环境需求，Filmetrics也可以提供多样的透镜配件及光学探头夹具供用户选择使用。

FILMETRICS

F37

薄膜分析仪



	SPEC-2-UV	SPEC-2	SPEC-2-NIR	SPEC-2-XT
测量范围*:	3 纳米-40 微米	15 纳米-100 微米	100 纳米-250 微米	500 纳米-1 毫米
测量n和k值的厚度要求*:	50 纳米以上	100 纳米以上	300 纳米以上	-
波长范围:	200-1100 纳米	380-1050 纳米	950-1700 纳米	1590 -1650 纳米
准确度*:	依厚度范围不同取0.4%或2纳米 (SPEC-2-XT为5纳米) 之较大者			
精度 ¹ :	0.1 纳米		0.2 纳米	2.5 纳米
稳定性 ² :	0.07 纳米		0.12 纳米	2.5 纳米
斑点尺寸:	标准1.5 毫米			
样品尺寸:	直径从1 毫米到300毫米			
光源:	氙光灯或 钨卤素灯		钨卤素灯	

提供定制化的波长组合

* 取决于材料。

¹ 标准偏差为一天内在Si基底上对厚度为500nm的SiO₂薄膜样品连续测量100次所得厚度值的标准偏差。该值为连续20天测量的标准偏差值的平均值。

² 2σ 是基于连续20天，每天在基底上对厚度为500nm的SiO₂薄膜样品连续测量100次所得厚度值上得出。

基本要求

电源:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6-0.3 A
电脑要求	
操作系统:	Windows XP-SP2-Windows 8 (64-bit)
系统内存:	至少 50 MB
硬盘空间:	至少 60 MB
界面:	USB 2.0
互联网:	建议联网以便网上支持
认证:	CE EMC和欧洲安全指令

FILMETRICS

Filmetrics, Inc.
3560 Dunhill St., Ste. 100
San Diego, CA 92121
Tel: +886-6-505-5180
<http://cn.filmetrics.com>

内容如有更改，恕不另行通知。
©2013 Filmetrics, Inc. Rev. 4.13
Printed in the USA